

METHOD OF FORMING PATTERN, AND COLOR FILTER

Patent number: JP2001222003
 Publication date: 2001-08-17
 Inventor: SUMINO TOMONOBU
 Applicant: DAINIPPON PRINTING CO LTD
 Classification:
 - International: G02F1/1335; G02B5/20; G09F9/00
 - european:
 Application number: JP20000033024 20000210
 Priority number(s): JP20000033024 20000210

Abstract of JP2001222003

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method of forming pattern by which a rugged relief pattern can be formed with high accuracy, and to provide a color filter which has columnar projection parts to set the thickness of a liquid crystal layer and which makes the production of a color liquid crystal display device having excellent display quality possible. **SOLUTION:** In the method of forming pattern, a negative photosensitive resin composition is applied to form a photosensitive resin layer on the body where a pattern is to be formed, and the photosensitive resin layer is exposed through a mask having a plurality of minute openings formed almost all over the mask face and a plurality of openings of a specified pattern and then developed to form a rugged relief pattern. The color filter consists of a substrate, a color layer of a plurality of colors formed on the substrate into a specified pattern, a transparent protective layer formed to cover at least the color layer, and transparent columnar projections formed in a plurality of specified position on the substrate and protruding from the transparent protective layer. The columnar projection parts and the transparent protective layer are formed at a time by the above method of forming pattern.

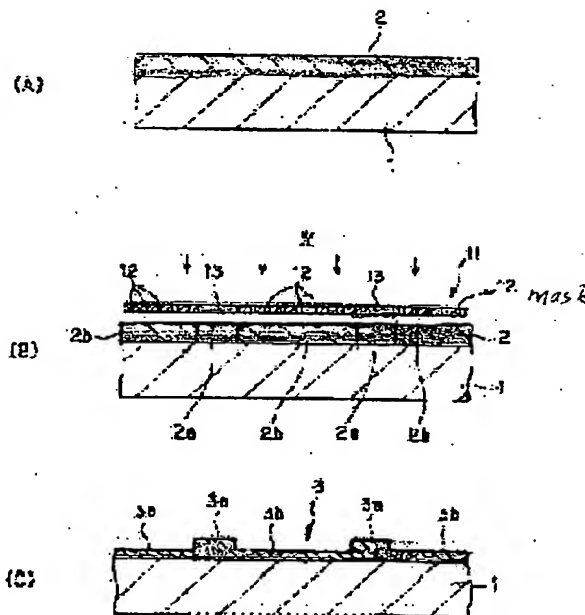


FIG. 1

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許公開番号

特開2001-222003

(P2001-222003A)

(43) 公開日 平成13年8月17日 (2001.8.17)

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	FI	キーワード (参考)
G 0 2 F 1/1335	5 0 5	G 0 2 F 1/1335	5 0 5 2 H 0 4 8
G 0 2 B 5/20	1 0 1	G 0 2 B 5/20	1 0 1 2 H 0 9 1
G 0 9 F 9/00	3 3 0	G 0 9 F 9/00	3 3 0 D 5 C 4 3 5

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 8 項)

(21) 出願番号 特願2000-33024 (P2000-33024)

(22) 出願日 平成12年2月10日 (2000.2.10)

(71) 出願人 000002897

大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

(72) 発明者 角野 友信

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社内

(73) 代理人 100095403

弁理士 奥田 潤三 (外1名)

Pターム (参考) 2H04B B308 B337 B342

2H09I FA02Y FA35I FB04 FC02

GM01 GA08 GA13 GA16

5G135 AA17 CC09 CC12 GG12 HB02

KK07

(54) 発明の名称 パターン形成方法及びカラーフィルタ

(57) 要約

【課題】 高い精度で凹凸レリーフを形成できるパターン形成方法及び、液晶層の厚み設定用としての柱状凸部を備え、表示品質に優れたカラー液晶表示装置の製造を可能とするカラーフィルタを提供する。

【解決手段】 パターン形成方法を、ネガ型感光性樹脂組成物をパターン被形成物上に塗布して感光性樹脂層を形成し、この感光性樹脂層を、全面にほぼ均一に露けられた複数の微細開口と所定パターンで形成された複数の開口部とからなるマスクを介して露光し現像することにより凹凸レリーフを形成するものとし、カラーフィルタを、基板と、基板上に所定のパターンで形成された複数の色からなる着色層と、少なくとも着色層を覆うように形成された透明保護層と、基板上の複数の所定部位に形成された透明保護層よりも突出した透明な柱状凸部とを備え、柱状凸部と透明保護層を上記のパターン形成方法により一併形成したものとす。

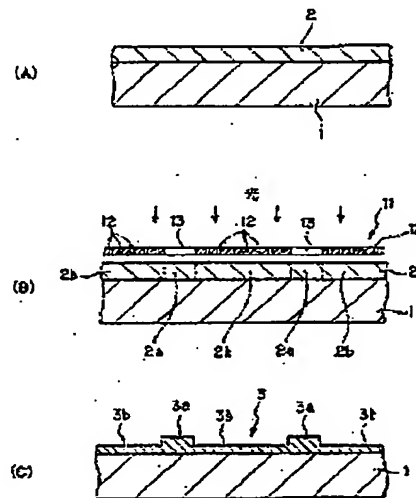


FIG. 1

(2)

特開2001-222003

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 パターン形成物上に、ネガ型の感光性樹脂組成物を塗布して感光性樹脂層を形成し、全面にはば均一に設けられた複数の微細開口と所定パターンで形成された複数の開口部とからなるマスクを介して前記感光性樹脂層を露光し現像することにより凹凸レリーフを形成することを特徴とするパターン形成方法。

【請求項2】 前記微細開口は、円形、楕円形、三角形、四角形、六角形のいずれかであり、開口幅は0.5～4 μmの範囲であることを特徴とする請求項1に記載のパターン形成方法。

【請求項3】 前記微細開口は、スリット形状であり、スリット幅は0.5～4 μmの範囲であることを特徴とする請求項1に記載のパターン形成方法。

【請求項4】 基板と、該基板上に所定のパターンで形成された複数の色からなる着色層と、少なくとも前記着色層を覆うように形成された透明保護層と、前記基板上の複数の所定部位に形成された前記透明保護層よりも突出した透明な柱状凸部とを備え、該柱状凸部および前記透明保護層は請求項1乃至請求項3のいずれかに記載のパターン形成方法により一括形成したものであることを特徴とするカラーフィルタ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、パターン形成方法と表示品質に優れたカラー液晶表示装置の製造が可能なカラーフィルタに関する。

【0002】

【従来の技術】 近年、フラットディスプレイとして、カラー液晶表示装置が注目されている。カラー液晶表示装置の一例として、ブラックマトリックス、複数の色（通常、赤（R）、緑（G）、青（B）の3原色）からなる着色層、透明電極層（共通電極）および配向層を備えたカラーフィルタと、薄膜トランジスタ（TFT素子）、画素電極および配向層を備えたTFTアレイ基板とを所定の間隔をもたせて向かい合わせ、この間隔部に液晶材料を注入して液晶層としたものがある。このようなカラー液晶表示装置では、間隔部が液晶層の厚みそのものであり、カラー液晶表示装置に要求される高応答性、高コントラスト比、広視野角等の良好な表示性能を可能とするためには、液晶層の厚み、すなわち、カラーフィルタとTFTアレイ基板の間隔距離を厳密に一定に保持する必要がある。

【0003】 従来、カラー液晶表示装置における液晶層の厚みを決定する方法として、カラーフィルタとTFTアレイ基板との間隔に、ガラスやアルミナ、プラスチック等からなるスペーサーと称する粒子あるいは柱状体を多数混合した液晶を注入する方法がある。そして、スペーサーの大きさをもって両基板の間隔部の大きさ、つまり、液晶層の厚みが決定される。

2

【0004】 しかし、上述のようなカラーフィルタとTFTアレイ基板との間隔部を形成する方法では、カラー液晶表示装置の製作の上で次のような問題点が生じる。すなわち、基板面上に散在させるスペーサーの密度が適正で、かつ、基板面上にスペーサーが均一分散されていなければ、カラー液晶表示装置の全面に亘って大きさが均一な間隔部は形成されない。一般に、スペーサーの散在量（密度）を増した場合、間隔部の厚みのばらつきは少なくなるが、散在量（密度）が多くなると表示画素部に存在するスペーサーの数も増し、表示画素部ではこのスペーサーが液晶材料の異物となる。そして、スペーサーの存在によって、配向膜で規制された液晶分子の配向に乱れが生じたり、スペーサー周辺の液晶だけは電圧のON、OFFによる配向制御が不能になる等の支障がみられ、コントラスト比等の表示性能が低下するという問題があった。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 このような問題を解消するために、間隔（液晶層の厚み）を決定するための柱状凸部を備えたカラーフィルタが提案されている（特開平4-318816号等）。上記のようなカラーフィルタでは、着色層を形成し、この着色層を覆うように保護層を形成した後、光硬化性樹脂を用いてフォトリソグラフィ工程により柱状凸部をブラックマトリックス上の所定箇所に形成するものである。

【0006】 しかしながら、保護層形成後に、再度フォトリソグラフィ工程を経て柱状凸部のレリーフパターンを形成しなければならず、カラーフィルタの製造工程が煩雑であり、スループット、歩留等が問題となっている。

【0007】 本発明は、上記のような事情に鑑みてなされたものであり、高い精度で凹凸レリーフを形成できるパターン形成方法と、液晶層の厚み設定用としての柱状凸部を備え、表示品質に優れたカラー液晶表示装置の製造を可能とするカラーフィルタとを提供することを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】 このような目的を達成するために、本発明のパターン形成方法は、パターン形成物上に、ネガ型の感光性樹脂組成物を塗布して感光性樹脂層を形成し、全面にはば均一に設けられた複数の微細開口と所定パターンで形成された複数の開口部とからなるマスクを介して前記感光性樹脂層を露光し現像することにより凹凸レリーフを形成するような構成とした。

【0009】 また、本発明のパターン形成方法は、前記微細開口が円形、楕円形、三角形、四角形、六角形のいずれかであり、開口幅は0.5～4 μmの範囲であるような構成、前記微細開口がスリット形状であり、スリット幅は0.5～4 μmの範囲であるような構成とした。

【0010】 本発明のカラーフィルタは、基板と、該基

50

(3)

特開2001-222003

3

板上に所定のパターンで形成された複色色からなる着色層と、少なくとも前記着色層を覆うように形成された透明保護層と、前記基板上の複色の所定部位に形成され前記透明保護層よりも突出した透明な柱状凸部とを備え、該柱状凸部および前記透明保護層は上記のパターン形成方法により一括形成したものであるような構成とした。

【0011】このような本発明では、マスクの開口部から入射した光で露光された部位は硬化反応が進むので、現像により凸部が形成され、一方、それ以外の感光性樹脂層ではマスクの微細開口から入射した光のエネルギーにより低度の硬化反応が生じ、現像により上記凸部よりも低い部分が残って凹凸レリーフが形成され、このパターン形成方法により透明保護層とともに一括形成された複色の透明な柱状凸部は、液晶層の厚み設定用スペーサとして必要な高さをもつとともに高精度の高さ設定が可能であり、また、透明保護層はカラーフィルタ表面を平坦化するとともに、着色層に含有される成分の液晶層への溶出を防止する。

【0012】

【発明の実施の形態】以下、本発明の最良の実施形態について図面を参照して説明する。

パターン形成方法

図1は、本発明のパターン形成方法の一実施形態を説明するための工程図である。

【0013】図1において、まず、パターン被形成物1上にネガ型の感光性樹脂組成物を塗布し乾燥して感光性樹脂層2を形成する(図1(A))。使用するネガ型の感光性樹脂は、公知の種々のネガ型感光性樹脂の中から、形成する凹凸レリーフに要求される光透過率や機械的強度等の特性を考慮して選択することができる。感光性樹脂層2の厚みは、形成する凹凸レリーフの高さ、使用するネガ型感光性樹脂組成物等により適宜設定できるが、適宜、3~8μmの範囲が好ましい。

【0014】次に、この感光性樹脂層2をフォトマスク11を介して露光する(図1(B))。使用するフォトマスク11は、全面にほぼ均一に設けられた複数の微細開口12と、所定パターンで形成された複数の開口部13とを備えている。図2(A)は、このようなフォトマスク11の部分拡大平面図である。図示例では、フォトマスク11の微細開口12の形状は円形であるが、これに限定されるものではなく、楕円形、三角形、四角形、六角形等のいずれの開口形状であってもよい。このような微細開口12の開口幅 W_1 は、0.5~4μm、隣接する微細開口12の非形成幅 W_2 は、 $[W_1 \leq W_2 \leq (W_1 + 1)]$ の関係(単位はμm)を満足する範囲で設定することが好ましい。開口幅 W_1 が0.5μm未満であると、凹凸レリーフを構成する厚膜形成のための必要な露光量が得られず、また、開口幅 W_1 が4μmを超えると、露光量が大きくなり過ぎて厚膜形成が困難になる場合がある。

4

【0015】さらに、本発明では、フォトマスクとして、図2(B)に示されるように、微細開口12がスリット形状であるフォトマスク11'を使用することができる。この場合、スリット幅 W_1 は0.5~4μm、隣接するスリット(微細開口12)の非形成幅 W_2 は、 $[W_1 \leq W_2 \leq (W_1 + 1)]$ の関係(単位はμm)を満足する範囲で設定することが好ましい。スリット幅 W_1 が0.5μm未満であると、凹凸レリーフを構成する厚膜形成のための必要な露光量が得られず、また、開口幅 W_1 が4μmを超えると、露光量が大きくなり過ぎて厚膜形成が困難になる場合がある。

【0016】このような露光により、感光性樹脂層2に露光部位2aと低露光部位2bとが形成される。露光部位2aは、フォトマスク11の開口部13から入射した光で露光されて硬化反応が大きく進んでいる。また、低露光部位2bは、フォトマスク11の微細開口12から入射した光のエネルギーにより低度の硬化反応が生じている。

【0017】次に、現像液によって感光性樹脂層2の現像が行われる。この現像では、硬化反応が大きく進行している露光部位2aが凸部となり、低露光部位2bでは一部が除去されて薄膜が形成される。その後、ポストベーク処理を行うことにより、凸部3aと平坦部3bからなる凹凸レリーフ3が形成される(図1(C))。上記のような本発明のパターン形成方法では、形成する凹凸レリーフ3の凸部3aの高さは、微細開口12の開口幅や非形成幅の設定、露光量の調整等により高い精度で制御することができる。

【0018】カラーフィルタ

図3は本発明のカラーフィルタの実施形態の一例を示す部分平面図であり、図4はA-A線における縦断面図である。図3および図4において、本発明のカラーフィルタ21は、基板22と、この基板22上に形成されたブラックマトリックス23および着色層25を備え、ブラックマトリックス23および着色層25を覆うように透明保護層26が形成されており、さらに、ブラックマトリックス23の所定の複数の箇所(図3では5箇所)には透明な柱状凸部27が上記の透明保護層26上に形成されている。

【0019】上記のカラーフィルタ21を構成する基板22としては、石英ガラス、パイレックスガラス、合成石英板等の可塑性のない透明なリジット材、あるいは透明樹脂フィルム、光学用樹脂板等の可塑性を有する透明なフレキシブル材を用いることができる。この中で特にコーニング社製7059ガラスは、熱膨張率の小さい素材であり寸法安定性および高温加熱処理における作業性に優れ、また、ガラス中にアルカリ成分を含まない無アルカリガラスであるため、アクティブマトリックス方式によるカラー液晶表示装置用のカラーフィルタに適している。

50

(4)

特開2001-222003

5

【0020】また、カラーフィルタ21を構成するブラックマトリックス23は、青色層25からなる表示画面部の間および青色層25の形成領域の外側に設けられている。このようなブラックマトリックス23は、スパッタリング法、真空蒸着法等により厚み1000~2000Å程度のクロム等の金属薄膜、または、カーボン微粒子等の遮光性粒子を含有させたポリイミド樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂等の樹脂層を形成し、このような金属薄膜または樹脂層上にパターンニングされた感光性樹脂層をエッチング処理することにより形成したもの、カーボン微粒子、金属化合物等の遮光性粒子を含有させた感光性樹脂層を形成し、この感光性樹脂層をパターンニングして形成したもの等、いずれであってもよい。

【0021】青色層25は、赤色パターン25R、緑色パターン25Gおよび青色パターン25Bが所望のパターン形状で配列されており、所望の青色材を含有した感光性樹脂を使用した塗料分散法により形成することができ、さらに、印刷法、塗布法、転写法等の公知の方法により形成することができ、また、青色層25を、例えば、赤色パターン25Rが最も薄く、緑色パターン25G、青色パターン25Bの順に厚くすることにより、青色層25の青色ごとに最適な液晶層厚みを設定するようにしてもよい。

【0022】透明保護層26はカラーフィルタ21の表面を平坦化するとともに、青色層25に含まれる成分の液晶層への溶出を防止するために設けられたものである。この透明保護層26の厚みは、使用される材料の光透過率、カラーフィルタ21の表面状態等を考慮して設定することができ、例えば、0.1~1.5μmの範囲で設定することができる。このような透明保護層26は、カラーフィルタ21をTFTアレイ基板と貼り合わせたときに液晶層と接するような青色層25を少なくとも覆うように形成される。

【0023】また、柱状凸部27は、カラーフィルタ21をTFTアレイ基板と貼り合わせたときにスペーサーとして作用するものである。この柱状凸部27は、上記の透明保護層25よりも2~7μm程度の範囲で突出するように一定の高さをもつものであり、突出量はカラー液晶表示装置の液晶層に要求される厚み等から適宜設定することができる。柱状凸部27の形成精度は、液晶層の厚みムラ、開口率、柱状凸部27の形状、材質等を考慮して適宜設定することができるが、例えば、青色層25を構成する赤色パターン25R、緑色パターン25Gおよび青色パターン25Bの1組に1個の割合で必要十分なスペーサー機能を実現する。尚、図示例では、柱状凸部27は円柱形状となっているが、これに限定されるものではなく、角柱形状、錐形柱形状等であってもよい。

【0024】上記の透明保護層26および透明な柱状凸部27は、上述の本発明のパターン形成方法により一括

形成されたものである。

【0025】ここで、本発明のパターン形成方法による透明保護層26と柱状凸部27の一括形成の説明を兼ね、本発明のカラーフィルタ21の製造について図5および図6を参照しながら説明する。まず、基板22上にブラックマトリックス23を形成し、次いで、基板22上の赤色パターン形成領域に赤色パターン25R、緑色パターン形成領域に緑色パターン25G、さらに、青色パターン形成領域に青色パターン25Bを形成して青色層25とする（図5(A)）。次に、ブラックマトリックス23および青色層25を覆うように、透明なネガ型感光性樹脂組成物を塗布して感光性樹脂層28を形成する（図5(B)）。

【0026】上記のブラックマトリックス23の形成は、例えば、以下のように行うことができる。まず、スパッタリング法、真空蒸着法等により形成したクロム等の金属薄膜、カーボン微粒子等の遮光性粒子を含有した樹脂層等からなる遮光層を基板22上に形成し、この遮光層上に公知のポジ型あるいはネガ型の感光性レジストを用いて感光性レジスト層を形成する。次いで、感光性レジスト層をブラックマトリックス用のフォトマスクを介して露光、現像し、露出した遮光層をエッチングした後、残存する感光性レジスト層を除去することによって、ブラックマトリックス23を形成する。

【0027】また、上記の青色層25の形成は、例えば、以下のように行うことができる。まず、ブラックマトリックス23を覆うように基板22上に赤色青色材を含有した赤色感光性樹脂層を形成し、所定のフォトマスクを介して上記の赤色感光性樹脂層を露光して現像を行うことにより、基板22上の赤色パターン形成領域に赤色パターン25Rを形成する。以下、同様に、基板22上の緑色パターン形成領域に緑色パターン25Gを形成し、さらに、基板22上の青色パターン形成領域に青色パターン25Bを形成する。

【0028】また、上記の感光性樹脂層28は、透明のネガ型感光性樹脂組成物を、粘度の最適化を行った上で、スピンコート、ロールコート等の公知的手段によりブラックマトリックス23および青色層25を覆うように塗布し乾燥することにより形成することができる。ネガ型感光性樹脂組成物は、上述のパターン形成方法で使用可能な種々のネガ型感光性樹脂から適宜選択して調製した感光性樹脂組成物を使用することができる。

【0029】次に、感光性樹脂層28を柱状凸部形成用のフォトマスク31を介して露光する（図6(A)）。使用するフォトマスク31は、全面にほぼ均一に設けられた複数の透射開口32と、所定パターンで形成された複数の開口部33とを備えている。この露光により、感光性樹脂層28に、開口部33から入射した光で露光された露光部位と、透射開口32から入射した光で露光された低露光部位とが形成される。露光部位では架橋反応

(5)

特開2001-222003

7

が若しく進行し、一方、低露光部位では、低度の硬化反応が生じている。

【0030】次いで、現像液によって感光性樹脂層28の現像が行われる。この現像では、硬化反応が大きく進行している柱状凸部形成部位（露光部位）の感光性樹脂層28は溶解されずに柱状凸部のパターンとして残る。また、低露光部位は、一部が溶解されるものの、一部は溶解されずに透明保護層のパターンとして残る。その後、加熱処理（ポストベーク）を行うことによって、透明保護層26と柱状凸部27とが一括形成された本発明のカラーフィルタ21が得られる（図6（B））。

【0031】上述のような透明保護層26と柱状凸部27の一括形成では、感光性樹脂層28の露光量や、使用するフォトマスク31の微細開口32の開口幅等を調整することにより、透明保護層26の厚みと柱状凸部27の突出量を高い精度で制御することができる。また、感光性樹脂層28の1回の露光・現像で透明保護層26と柱状凸部27とが一括形成されているので、柱状凸部27の位置精度が極めて高く、工程も簡便なものであり、カラーフィルタ21の製造においてスループット、歩留が良好である。

【0032】上記の柱状凸部27を備える本発明のカラーフィルタ21に配向層を設けて配向処理（ラビング）した後、TFTアレイ基板と貼り合わせた場合、柱状凸部27がカラーフィルタ21とTFTアレイ基板との間に隙隙を形成する。そして、上述のような柱状凸部27はスペーサーとしての機能を発現し、両基板の間隔精度は極めて高いものとなる。尚、本発明のカラーフィルタは、ブラックマトリックス23を備えず、非露光部分に相当する位置に上述の柱状凸部27を形成したものであってもよい。

【0033】

【実施例】次に、実施例を示して本発明を更に詳細に説明する。

【0034】（実施例1）カラーフィルタ用の基板として、300mm×400mm、厚さ1.1mmのガラス基板（コーニング社製7059ガラス）を準備した。この基板を定法にしたがって洗浄した後、基板の片面全面にスパッタリング法により金属クロムからなる透光層（厚さ0.1μm）を形成した。次いで、この透光層に対して、通常のフォトリソグラフィ法によって感光性レジスト塗布、マスク露光、現像、エッチング、レジスト層剥離を行ってブラックマトリックスを形成した。

【0035】次に、ブラックマトリックスが形成された基板全面に、赤色パターン用の感光性着色材料（富士フィルムオーリン（株）製カラーモザイクCR-7001）をスピンコート法により塗布して赤色感光性樹脂層を形成し、プレベーク（85℃、5分間）を行った。その後、所定の着色パターン用フォトマスクを用いて赤色感光性樹脂層をアライメント露光し、露光液（富士フ

8

ィルムオーリン（株）製カラーモザイク用現像液CDの希釈液）にて現像を行い、次いで、ポストベーク（200℃、30分間）を行って、ブラックマトリックスパターンに対して所定の位置に赤色パターン（厚み1.5μm）を形成した。

【0036】同様に、緑色パターン用の感光性着色材料（富士フィルムオーリン（株）製カラーモザイクCG-7001）を用いて、ブラックマトリックスパターンに対して所定の位置に緑色パターン（厚み1.5μm）を形成した。さらに、青色パターン用の感光性着色材料（富士フィルムオーリン（株）製カラーモザイクCB-7001）を用いて、ブラックマトリックスパターンに対して所定の位置に青色パターン（厚み1.5μm）を形成した。

【0037】次に、着色層が形成された基板上に透明なネガ型感光性樹脂組成物（JSR（株）製NN700）をスピンコート法により塗布し乾燥して、厚み7μmの透明感光性樹脂層を形成した。

【0038】次いで、超高圧水銀灯を露光光源とするプロキシミティ露光機にて、フォトマスクを介して300mJ/cm²の露光量で露光を行った。使用したフォトマスクは、図2（A）に示されるように、柱状凸部の形成位置に直径15μmの円形の開口部を備え、他の領域に直径2μmの円形の微細開口を非形成幅4μmで備えたものであった。次に、基板を現像液（KOH、0.5重量%水溶液）に60秒間浸漬して現像を行い、洗浄後、クリーンオープン中で加熱処理（230℃、30分間）を行った。

【0039】このような一連の操作により、露光部位には高さ4.0μmの透明な円柱形状の柱状凸部が形成され、微細開口による低露光部位には厚み2.3μmの透明保護層が形成されて、図3および図4に示されるような構造のカラーフィルタを得た。

【0040】（実施例2）円形の微細開口の直径を1.5μmとし、隣接する微細開口の非形成幅2μmとしたフォトマスクを使用した他は、実施例1と同様にして、図3および図4に示されるような構造のカラーフィルタを得た。

【0041】このカラーフィルタは、高さが4.8μmである透明な柱状凸部と、これと一括形成された厚み1.5μmの透明保護層を備えるものであった。

【0042】（実施例3）フォトマスクとして、図2（B）に示されるように、柱状凸部の形成位置に直径15μmの円形の開口部を備え、他の領域にスリット幅2μmの微細開口を非形成幅2μmで備えたフォトマスクを使用した他は、実施例1と同様にして、図3および図4に示されるような構造のカラーフィルタを得た。このカラーフィルタは、高さが4.8μmである透明な柱状凸部と、これと一括形成された厚み1.5μmの透明保護層を備えるものであった。

(5)

特開2001-222003

10

【0043】

【発明の効果】以上詳述したように、本発明によればマスクの微細開口から入射した光による感光性樹脂層の露光と、マスクの開口部から入射した光による感光性樹脂層の露光とが行われ、マスクの開口部から入射した光で露光された部位では硬化反応が進み、それ以外の領域では感光性樹脂層に低度の硬化反応が生じることになり、現像により上記の開口部に対応した凸部が形成され、それ以外の領域には薄膜が残り、高精度の凹凸レリーフを断面に形成することができ、このような本発明のパターン形成方法により一括形成された透明保護層と透明な柱状凸部を備えるカラーフィルタでは、多数の透明な柱状凸部は、液晶層の厚み設定用スペーサとして必要な高さをもち、また、感光性樹脂層の1回の露光で透明保護層と一体に形成できるので位置精度も極めて高いものであり、液晶層の厚み制御に高い精度を要求されるカラー液晶表示装置にも対応することができ、上記透明保護層はカラーフィルタ表面を平坦化するとともに、着色層に含有される成分の液晶層への溶出を防止するので、表示品質に優れた信頼性の高いカラー液晶表示装置が可能となり、このようなカラーフィルタは、工程も簡便なものであり、製造におけるスループット、歩留が良好である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のパターン形成方法の一実施形態を説明するための工程図である。

【図2】本発明のパターン形成方法に使用するフォトマスクの2つの例を示す部分拡大平面図である。

【図3】本発明のカラーフィルタの実態形態の一例を示す

* ず部分平面図である。

【図4】図3に示された本発明のカラーフィルタのA-A線における断面図である。

【図5】本発明のカラーフィルタの製造例を説明するための工程図である。

【図6】本発明のカラーフィルタの製造例を説明するための工程図である。

【符号の説明】

- 1…パターン模形成物
- 2…感光性樹脂層
- 2a…露光部位
- 2b…低露光部位
- 3…凹凸パターン
- 3a…凸部
- 3b…平坦部
- 11…フォトマスク
- 12…微小開口
- 13…開口部
- 21…カラーフィルタ
- 22…基板
- 23…ブラックマトリクス
- 25…着色層
- 26…透明保護層
- 27…柱状凸部
- 28…感光性樹脂層
- 31…フォトマスク
- 32…微小開口
- 33…開口部

【図4】

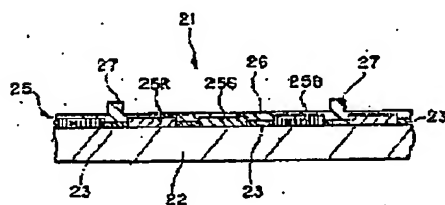


FIG. 4

【図6】

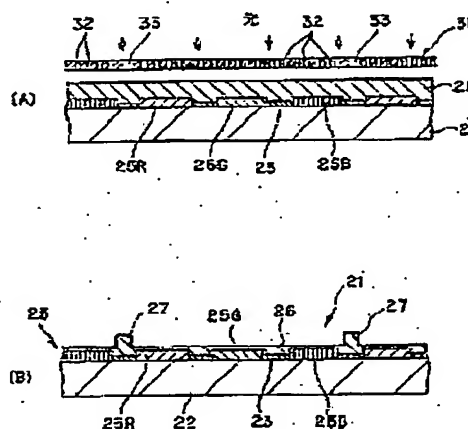


FIG. 6

(7)

特許2001-222003

【図1】

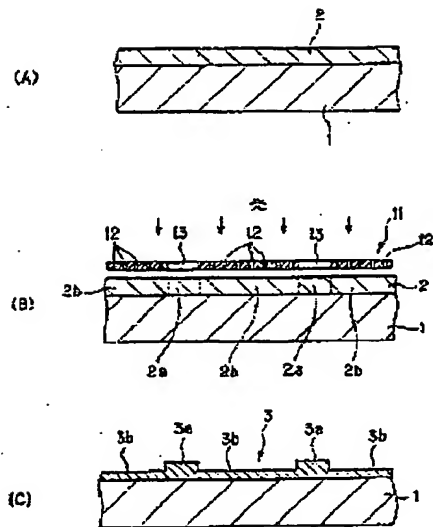


FIG. 1

【図2】

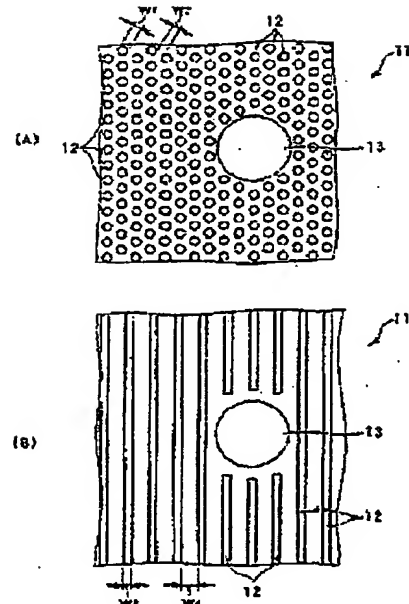


FIG. 2

【図5】

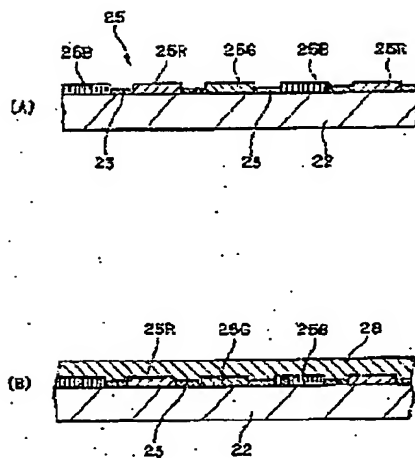


FIG. 5

(8)

特許2001-222003

【図3】

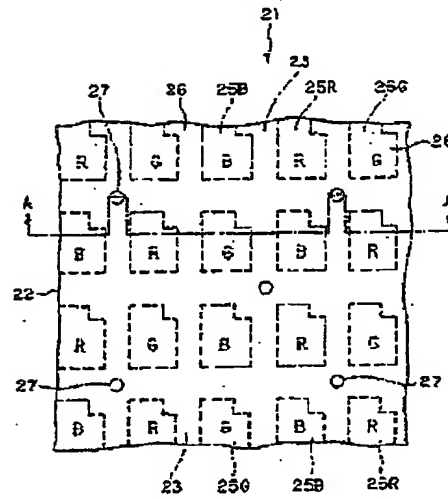


FIG. 3